

薄膜表面・界面評価法の新展開

New development of surface and interface evaluation methods for thin films

金属酸化物、窒化物、炭化物などの諸物性は、材料の物理的、化学的性質に大きく依存するが、それらの薄膜を部材・デバイスに応用する際には、金属、樹脂、セラミックス、単結晶など多様な基材との積層構造を有するため、機能性薄膜の諸物性は、界面反応や応力に依存する。また、デバイスの信頼性、長期安定性の向上には、材料表面や異種材料界面の制御が極めて重要である。本シンポジウムでは、機能と信頼性を両立した新規材料、部材、デバイス開発に向け、最新の薄膜材料・デバイス研究と計測研究（薄膜材料の界面や表面制御による機能発現、異種材料を用いた表面、界面の解明に必須な分析、評価技術の最新動向、更には、界面や表面制御技術）に関するシンポジウムを開催する。

日時:2019年9月19日(木) 9:00~18:00 [予定]

会場:北海道大学・札幌キャンパス

招待講演（敬称略・五十音順，仮題）

黒岩芳弘(広島大)	ペロブスカイト型強誘電体膜の放射光による構造評価
稲葉克彦(株式会社リガク)	X線回折法による表面・界面解析
池永英司(名大)	光電子分光法による薄膜構造解析
川山巖(阪大レーザー研)	テラヘルツ放射を利用した半導体表面・界面分析
森芳一(神戸製鋼)	縦型高分解能RBS分析によるサブナノメートル分析
村木直樹(東レリサーチセンター)	高感度・高空間分解能赤外顕微鏡の開発とナノデバイスへの応用
小林正起先生(東大院工)	超高分解能軟X線発光分光を用いた磁性半導体の電子構造解析
芝田悟朗(東理大)	X線磁気円二色性(XMCD)を用いたスピントロニクス材料への応用(調整中)
川上養一先生(京大院工)	近接場光学顕微鏡による窒化物半導体ナノ構造の光学評価
田畑仁(東大)	薄膜センサ・メモリ関連、エネルギーハーベスティング関連、バイオメディカル関連
澤彰仁(産総研)	酸化物薄膜・接合・超格子—界面物性と電子デバイス応用

一般講演数件募集

- 世話人：土屋哲男(産総研)，山本哲也(高知工科大)，西川博昭(近畿大)，中村吉伸(東大)，川原村敏幸(高知工科大)，阿部友紀(鳥取大)，田橋正浩(中部大)(順不同)
- 問合せ:tetsuo-tsuchiya@aist.go.jp